

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成28年5月26日(2016.5.26)

【公表番号】特表2015-521681(P2015-521681A)

【公表日】平成27年7月30日(2015.7.30)

【年通号数】公開・登録公報2015-048

【出願番号】特願2015-519014(P2015-519014)

【国際特許分類】

C 08 F 297/04 (2006.01)

C 08 F 212/02 (2006.01)

C 08 F 4/48 (2006.01)

【F I】

C 08 F 297/04

C 08 F 212/02

C 08 F 4/48

【手続補正書】

【提出日】平成28年3月30日(2016.3.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アニオン重合によるビニル芳香族ブロックコポリマーの製造方法であって、ビニル芳香族の重合が、不活性溶媒中に溶解されたn-アルキルリチウムと1,3-ジエンとを1:1~1:10のモル比にて-20~100の温度で反応させることによって得ることができる修飾n-アルキルリチウム開始剤を使用し、ここで、アニオン重合をビニル芳香族及びジエンのブロック重合として逐次的に行い、ここで、続いての重合工程が、ジエン又はビニル芳香族とジエンとの混合物の反応を含むことを特徴とする製造方法。

【請求項2】

分子中へ重合されたジエンのモノマー単位を1~5個含む、修飾n-アルキルリチウム開始剤を使用することを特徴とする、請求項1に記載のビニル芳香族ブロックコポリマーの製造方法。

【請求項3】

分子中へ重合されたジエンのモノマー単位を1~3個含む、修飾n-アルキルリチウム開始剤を使用することを特徴とする、請求項1に記載のビニル芳香族ブロックコポリマーの製造方法。

【請求項4】

修飾n-ブチルリチウム開始剤を使用することを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。

【請求項5】

スチレンをビニル芳香族として使用し、1,3-ブタジエンをジエンとして使用することを特徴とする、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。

【請求項6】

分子中へ重合された1,3-ジエンのモノマー単位を1~10個含む修飾n-アルキルリチウムの、ビニル芳香族のアニオン重合についての開始剤としての使用方法。